

ABSTRACT

物体面上に配置されたパターンを投影光学系の像面側に配置されたウエハ上に順次転写してマトリックス状の複数の区画領域から成る第1領域をウエハ上に形成するとともに、第1領域の周囲に過露光の第2領域を形成する。そして、複数の区画領域におけるパターンの像の形成状態を、コントラスト検出などの画像処理の手法により検出する。この場合、第1領域の外側に過露光の第2領域が存在するので、第1領域の最外周部の区画領域と第2領域の境界線をS/N比良く検出することができ、その境界線を基準として他の区画領域の位置をほぼ正確に算出できる。従って、パターン像の形成状態を短時間で検出することができる。